

<研究論文>

動電位 陽極分極法에 의한 스텐레스鋼의 孔蝕에 관한 研究

張 賢 球*

A Potentiokinetic Anodic Polarization Study of Pitting Corrosion on Stainless Steels

Hyun K. Chang

Abstract

The potentiokinetic anodic polarization method was applied to study the effects of some factors on pitting potential of stainless steel in 0.1N sulfuric acid solution containing chloride ion. Pitting potentials were varied with the potential scan rate and the surface roughness of specimen. The slow scan rate and the rough surface shifted the pitting potential to active direction. Increase in chloride ion concentration in 0.1N sulfuric acid solution reduced the pitting potential. Sensitizing treatment at 650°C lowered pitting potential and made pitting initiation easy.

抄 錄

動電位陽極分極法을 利用하여 鹽素이온을 含有한 N/10 H_2SO_4 溶液中 스텐레스鋼의 孔蝕電位에 미치는 몇 가지 因子들의 影響을 調査하였다. 孔蝕電位는 電位스캔速度와 試片表面의 微細研磨度에 따라 크게 變하여 느린 speed로 스캔ning(scanning)할수록, 表面이 거칠수록 낮은 값을 갖는다. 鹽素이온濃度의 增加는 孔蝕電位를 현저하게 低下시키며 650°C에서의 敏感化處理는 또한 孔蝕電位를 活性方向으로 낮추어 孔蝕發生을 容易하게 하여준다.

1. 序 論

分極測定을 할려는 電極의 電位를 補助電極에 대하여 一定하게 維持시켜 줄 目的으로 1942年 Hickling¹⁾이 最初로 設計하여 만들었던 Potentiostat는 1960年頃 이후로 腐蝕試驗에 자주 使用되어 왔다. Potentiostat를 使用하여 分極을 測定하는 方法은 電位를 變化시켜 주는 方式에 따라서 定電位法(potentiostatic method)과 動電位法(potentiokinetic method)의 두가지로 나눌 수 있다. 이들 方法들은 여러가지 金屬들의 孔蝕機構를 알아내는 데 利用되었으며 孔蝕에서 發生하는 特徵인 다음 두가지 電位值를 測定할 수 있었다. 즉 이들 電位라고 하는 것은 孔蝕이 發生하기 시작하는 孔蝕電位(pitting potential)^{2), 3), 4), 5)}와 成長을 防止할 수 있는 孔蝕防止電位(pitting protection potential)이다.

단계별로 電位를 손으로 制御하였던 初期의 電位變化法은 最近 스캔裝置의 開發에 의하여 필요한 speed로 繼續的으로 電位를 變化시킬 수 있는 動電位法으로 發

展하게 되었다.^{6), 7), 8), 9)} 이에 따라서 빠른 speed로 電位를 스캔ning함으로 짧은 시간동안에 金屬材料의 腐蝕特性을 알아내는 實驗이 가능하게 되었으며, 이를 適用하는데 대한 여러가지 長短點이 存在함을 몇몇 著者들은 比較研究를 통하여 論議하였다.^{10), 11)}

스텐레스鋼의 腐蝕에 있어서 孔蝕電位 또는 臨界孔蝕電位(critical pitting potential)의 存在는 Brennert¹²⁾에 의하여 처음 "break through potential"이라는 名稱으로 確認되었다. 그후 Potentiostat 및 Galvanostat와 같은 精密制御裝置를 使用한 研究를 통하여 이 電位값은 차로 明確한 意味를 갖게 되었다.^{13), 14), 15), 16), 17)} 따라서 요즈음에 있어서는 金屬材料의 孔蝕特性을 記述하는데 이 孔蝕電位의 概念이 定性的인 尺度로서 널리 通用되고 있다.

사실 孔蝕電位는 電位를 變化시키는 方式과 變化速度에 큰 影響을 받기 때문에 Uhlig etc.¹⁸⁾은 孔蝕電位를 어떤 材料의 어떤 雰圍氣中에서 一定值로 생작하지 않고 測定條件에 따라 決定되는 値으로 多루었다. 定電位分極測定에서나 動電位分極測定에 있어 모두, 電

* 成均館大學校 理工大學 助教授

位를變化시키는 경우에는完全平衡條件을維持할 수 없기 때문에測定에 의하여 얻은臨界孔蝕電位값은 항상眞臨界孔蝕電位(無限大 시간동안維持시킨 후에不動態가破壊되어孔蝕이發生하기 시작하는最少電位)보다 큰 값을 갖게된다.

이研究에서는오스테나이트계(18-8)스텐레스鋼과체라이트계(13Cr)스텐레스鋼에대하여 대기中室溫에서의陽極分極實驗을통하여스캔速度,鹽素이온濃度,電極表面粗度(roughness)및650°C에서의敏感化處理가孔蝕電位에미치는影響을검토하여보기로한다.

2. 實驗

이研究에서는오스테나이트계(18-8)스텐레스鋼및체라이트계(13Cr)스텐레스鋼試片을測定陽極으로使用하였다. 5mm정도두께의板材를10mm×10mm넓이로절단하여1,000°C에서1시간동안燒鈍處理한후물에넣어急冷시켰다. 敏感化處理의影響을調查한試片은650°C에서30분,60분및90분씩각각維持시킨후水冷시켰다. 表面을研磨한후2mm굵기의銅線을4cm로짤라測定하고자하는면에Fig.1과같이납땜한다음에폭시로mounting하였다. 銅線이溶液에닿지않도록리드線의上端을제외한모든부분은에

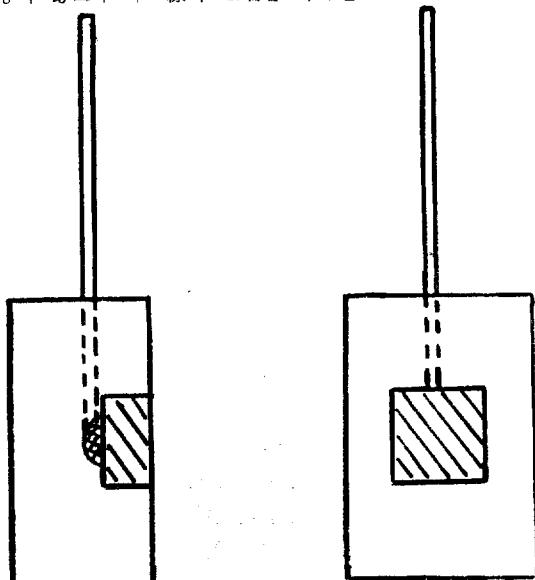


Fig. 1. Specimen mounting for working electrode.

폭시로피복시켰다. 電極表面은3/0에머리研磨紙까지갈아서Working Electrode(陽極)로使用하였으며 필요에따라서는더욱微細한研磨材로機械研磨를 행하였다. 종류수로N/10H₂SO₄溶液, N/10H₂SO₄+N/10NaCl溶液을만들어測定溶液으로제공하였다.

動電位陽極分極測定에使用된裝置의回路圖는다음Fig. 2와같다. 動電位는Linear scan indicator(Anotrol model 4510)를Magna Research Potentiostat(Anotrol model 4700M)와함께連結하여얻었으며X-Y Recorder(Honeywell Model 550)를使用하여電位電流變化를同時에自動記錄하였다.

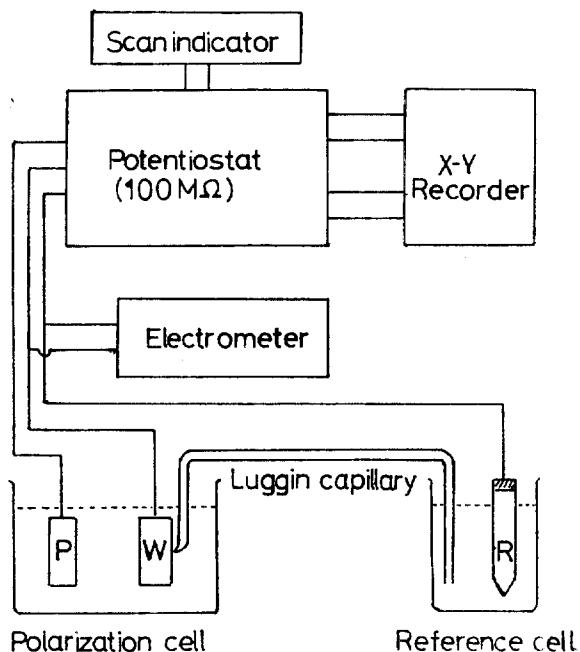


Fig. 2. Schematic wiring diagram for potentiokinetic anodic polarization measurement. (P : power electrode, W : working electrode, R : reference electrode)

電位의스캔速度(scan rate)는Scan Indicator에있는Time Selector Switch로조절하였으며Electrometer(K-eithley Model 601)를使用하여測定值들을補正하였다.

溶液을500ml容量의分極槽에채우고白金電極,陽極試片및Luggin Capillary를設置하였다. Luggin Capillary는補助電極으로使用된甘汞電極과連結하였다. 電極設置후5분정도지나고나서스캔電位領域및스캔시간을필요한스캔速度가되도록設定한다음活性領域에서貴電位方向으로連續的으로陽極電位를스캔ning시킴에따른電流의變化를X-Y Recorder에의하여記錄하였다.

3. 結果 및 檢討

대기中에노출된N/10H₂SO₄水溶液中室溫에서스캔速

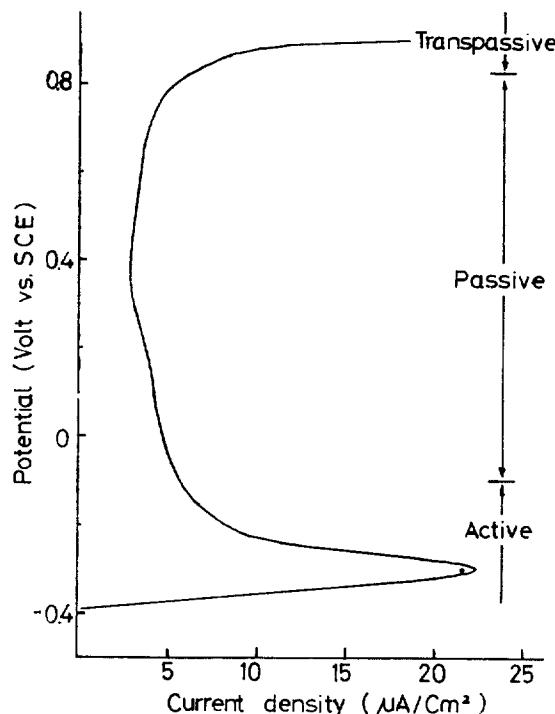


Fig. 3. Potentiokinetic anodic polarization curve of austenitic stainless steel in N/10 H_2SO_4 solution (scan rate, 150mv/min.)

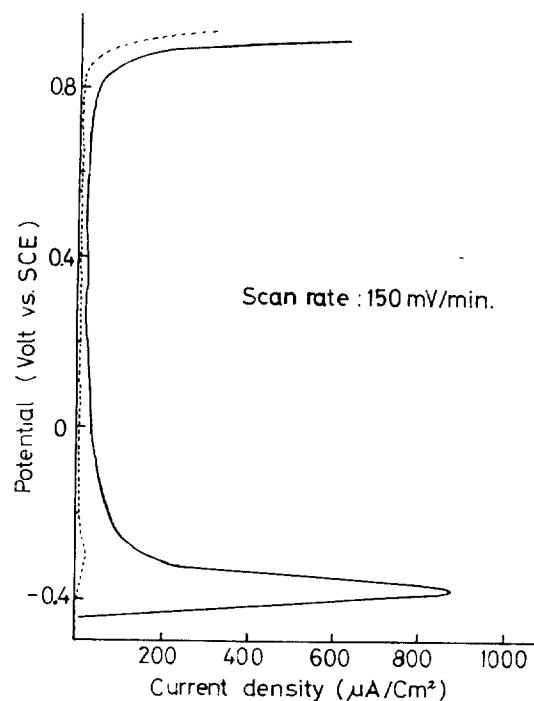


Fig. 4 Potentiokinetic anodic polarization curve of ferritic stainless steel in N/10 H_2SO_4 solution.

度 150mv/min.로 测定한 오스테나이트계 스텐레스鋼의 動電位陽極分極曲線은 Fig. 3과 같다. 自然電極電位인 낮은 電位領域에서부터 貴한 電位領域으로 陽極電位가 變함에 따라 活性態, 不動態, 및 過不動態의 세 가지 陽極狀態가 存在한다. 마찬가지로 위와 同一한 溶液 및 스캔速度에서 퀘라이트계 스텐레스鋼의 動電位陽極分極을 그려보면 Fig. 4와 같은 結果를 얻었다. Fig. 3의 오스테나이트계 스텐레스鋼의 分極曲線을 퀘라이트鋼과 비교하기 위하여 Fig. 4 위에 点線으로 表示하였다. 이 그림은 오스테나이트鋼의 電流密度가 活性 및 不動態領域에서 대략 퀘라이트鋼의 1/10정도의 낮은 값이 됨을 보여주고 있다. 이제부터 스캔速度, 鹽素이온濃度, 試片表面의 研磨度 및 敏感화處理등이 孔蝕電位에 미치는 影響에 대하여 項目別로 살펴보기로 한다.

1) 스캔速度의 影響

다음 Fig. 5는 N/10 H_2SO_4 水溶液中에서 스캔速度를 50, 150 및 500mv/min.로 다르게 해주었을 때 오스테나이트鋼 陽極의 動電位分極曲線을 보여준 것이다. 스캔速度가 느릴수록 Active peak 및 Passive minimum

의 電流密度가 減少하여 過不動態電位值는 약간 貴한 값으로 된다.

H_2SO_4 溶液中에서의 過不動態電位는 酸素發生에 起因된 것이며 스캔速度에 따라 그 값의 變動이 있다고 하더라도 孔蝕은 發生하지 않는다. 반면 鹽素이온이 共存할 경우 過不動態電位는 현저히 낮아지면서 孔蝕이 發生하기 때문에 이 電位值를 孔蝕電位라고 한다. N/10 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10\text{NaCl}$ 溶液中에서 퀘라이트鋼의 孔蝕電位에 미치는 스캔速度의 影響을 보면 Table 1과 같다.

Table 1. Effect of scan rate on pitting potential in ferritic stainless steel in N/10 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10\text{NaCl}$ solution.

Scan Rate (mv/min)	Pitting Potential (V vs SCE)
25	0.25
50	0.30
150	0.35

孔蝕電位는 스캔速度가 빨라짐에 따라 貴電位쪽으로

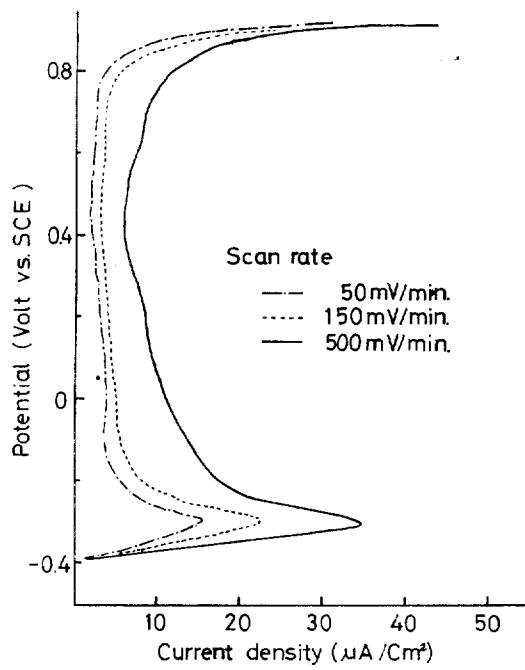


Fig. 5. Effect of scan rate on anodic polarization curve in N/10 H_2SO_4 .

移動함을 볼 수 있다.

2) 鹽素이온濃度의 影響

卑電位에서부터 過不動態領域까지 오스테나이트鋼을 分極시킬 때 鹽素이온이 存在하지 않는 溶液과 存在하는 溶液의 分極曲線을 比較하여 보면 Fig. 6과 같다. Fig. 6에서는 過不動態電位를 지나고나서 스캔方向을 反對로 계속 스캔ning시의 分極曲線도 나타내주었다. 鹽素이온이 存在하는 溶液중에서의 分極曲線의 特徵은 다음 두가지로 要約할 수 있다.

(1) 過不動態電位값이 卑電位 方向으로 變하면서 孔蝕이 發生함. (孔蝕電位)

(2) 電位反轉시에 히스테리시스(Hysteresis) 特性의 出現

Fig. 7 (a) (b)는 N/10 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10 \text{NaCl}$ 溶液中에서 50mv/min 的 스캔速度로 分極시켰을 때 發生한 孔蝕의 모양을 보여주는 것이다.

N/10 H_2SO_4 溶液中에 NaCl의 含量을 점차 增加시켰을 때 체라이트鋼에 孔蝕이 發生하는 電位와 히스테리시스曲線을 보면 Fig. 8과 같다. 이 曲線들에 의하면 鹽素이온濃度가 增加함에 따라서 孔蝕電位는 점차 낮

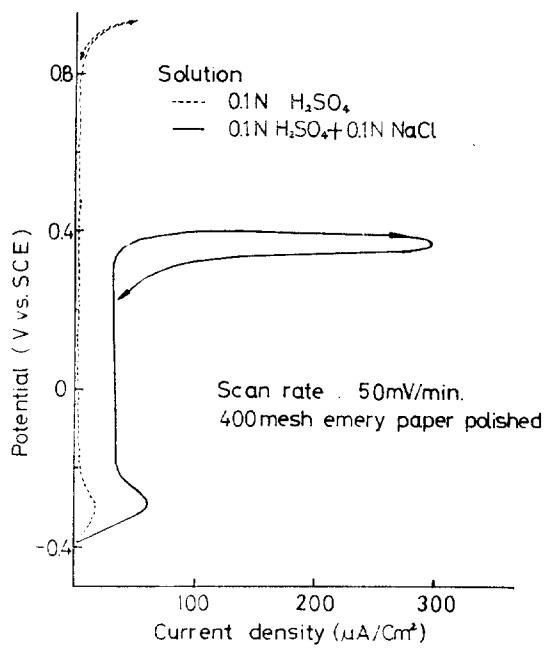


Fig. 6. Cyclic E-I diagram of austenitic stainless steel: --- in N/10 H_2SO_4 ; - in N/10 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10 \text{NaCl}$ (Scan rate; 50mv/min 400 mesh emery paper polished)

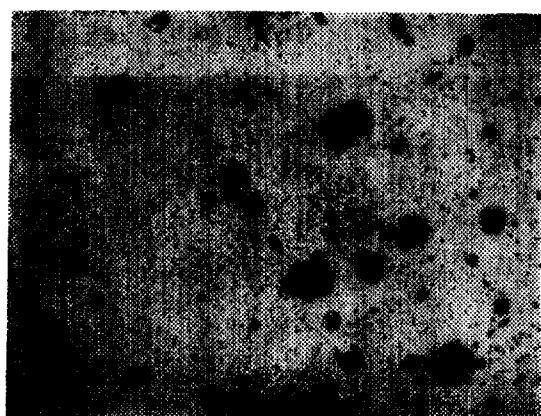
은 값을 갖게되고 히스테리시스 特性은 더욱더 현저하게 나타난다.

Table 2.는 오스테나이트 및 체라이트鋼의 孔蝕電位가 N/10 H_2SO_4 溶液中 NaCl濃度增加에 따라 150mv/min.의 스캔速度에서 어떻게 變하는가를 보여준 것이다.

Table 2. Pitting potential of stainless steels in various chloride concentration in N/10 H_2SO_4 , sol.

(scan rate 150mv/min, V vs. SCE)

concentration of NaCl kind of steel	0	N/10 NaCl	N/2 NaCl	1N NaCl
Austenitic stain- less steel	0.84V	0.66V	0.26V	0.17V
Ferritic stainless steel	0.76V	0.35V	0.06V	-0.09V



(a) Austenitic stainless steel.



(b) Ferritic stainless steel.

Fig. 7. Pitting of stainless

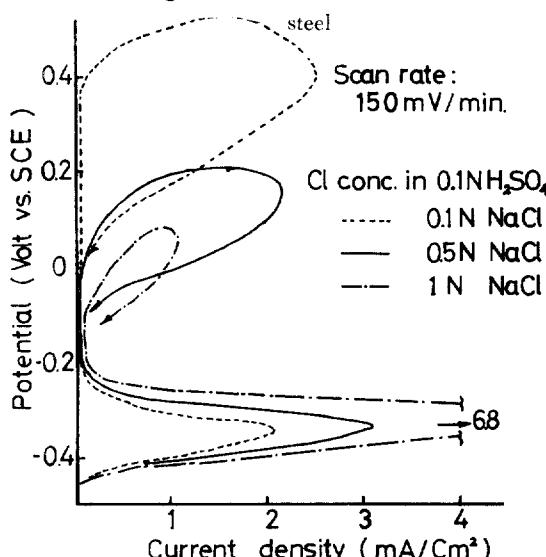


Fig. 8. The effect of chloride concentration on potentiokinetic E-I diagram

오스테나이트鋼에 있어서도 濃度를 增加시켜줄에 따라 孔蝕電位는 계속 떨어지게 된다.

3) 敏感化處理에 의한 影響

燒鈍하여 使用한 試片중의 一部는 650°C 에 加熱하여 敏感化處理를 행하였다. Fig. 9는 30분동안 敏感化處理된 퀘라이트鋼의 금속현 미경사진이다.

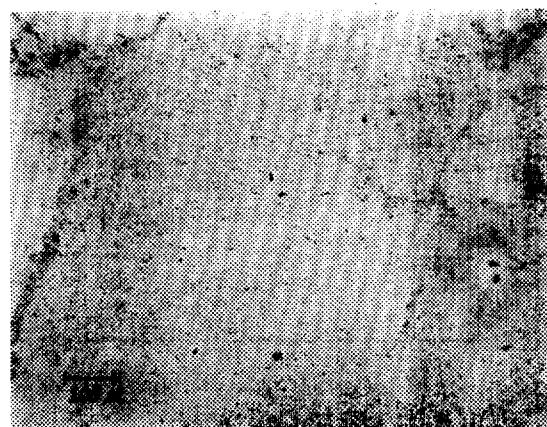


Fig. 9. Microstructure of sensitized ferritic stainless steel

이 사진에서 粒界에 크롬炭化物이 析出된 것을 볼 수 있다.

$\text{N}/10 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10 \text{NaCl}$ 溶液中에서 150mV/min의 스캔速度로 分極시킬 때 孔蝕電位는 敏感化處理時間에 따라 다음 Table 3과 같이 變하였다.

Table 3. Effect of sensitizing time on pitting potential (scan rate 150mV/min, V vs. SCE)

sensitizing time (min)	0	30	60	90
kind of steel				
Austenitic	0.66V	0.48V	0.43V	0.33V
Ferritic	0.35V	0.11V	-0.05V	-0.07V

오스테나이트 및 퀘라이트鋼 모두 敏感化處理에 의하여 孔蝕電位는 活性域으로 变함을 알 수 있다. 이들 鋼들은 또한 Fig. 10에서 보는 바와같이 敏感化에 의하여 增加된 分極電流密度를 갖는다.

4) 表面研磨度의 影響

오스테나이트鋼의 表面研磨狀態를 다르게 研磨하여 주었을 때 $\text{N}/10 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}/10 \text{NaCl}$ 溶液中 스캔速度 50mV/min로 分極시켜 얻은 孔蝕電位값을 Table 4에

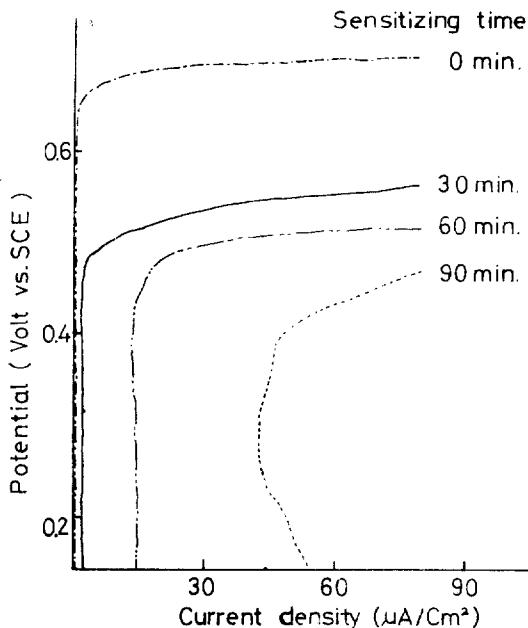


Fig. 10 Effect of sensitizing on potentiokinetic E-i curve.

보았다.

Table 4. Effect of surface roughness on pitting potential

Degree of polishing	pitting potential (V vs SCE)
0.03 μ Al ₂ O ₃ polishing	0.59
0.5 μ Diamond dust polishing	0.53
10 μ Diamond dust polishing	0.44
400mesh emery paper grinding	0.36

試片의 表面研磨度가 微細할수록 孔蝕電位는 높은 値를 보이며 表面이 거칠수록 孔蝕電位는 낮아져서 孔蝕의 發生이 容易하게 된다.

Fig. 11은 오스테나이트鋼에 發生한 孔蝕의 모양을 더욱 확대시켜 본 것이다. 이와같은 형상의 빗트(Pit)形態가 가장 典型的인 것으로 中央部가 깊숙히 侵蝕되어 있고 그 주위에 鮮明한 表面 그리고 가장 外側에는 거무스름한 Fe₃O₄酸化皮膜이 存在한다.

4. 結論

動電位 陽極分極法을 이용하여 鹽素이온을 含有한 0.1 N H₂SO₄溶液中에서 스텐레스鋼의 孔蝕電位에 미치는



Fig. 11 Pitting morphology of austenitic stainless steel.

몇 가지 因子들의 影響을 調査하여 본 결과 다음과 같은 結論을 얻었다.

- 1) 鹽酸水溶液中 鹽素이온濃度의 增加는 스텐레스鋼의 孔蝕電位를 活性值(낮은 値)로 變化시킨다.
- 2) 電位의 스캔速度는 孔蝕電位에 큰 影響을 주며 스캔速度가 빠를수록 測定된 孔蝕電位는 貴한 値으로 移動한다.
- 3) 650°C에서의 敏感化處理는 孔蝕電位를 活性方向으로 낮추어 준다.
- 4) 表面研磨狀態가 微細할수록 孔蝕電位는 貴한 値을 갖는다.

後記

이 研究는 1973年度 韓國腐蝕學會 研究獎勵金에 의하여 이루어진 것입니다. 이와같은 後援을 하여주신 學會 會長團任員들께 感謝드립니다. 또 이 研究를 遂行하는데 여러가지로 協助하여주신 韓國科學技術研究所 金屬材料研究室 및 材料試驗室의 여러분에게 아울러 謝意를 表하는 바입니다.

参考文獻

- 1) A. Hickling, Trans. Taraday Soc., 38, 29(1942)
- 2) W. Schwenk, Corrosion Science, 5, 245(1965)
- 3) J. Horvath and H. H. Uhlig, J. Electrochem. Soc., 115, 791(1968)
- 4) M. Pourbaix, Corrosion, 26, 431(1970)
- 5) H. P. Leckie, J. Electrochem. Soc., 117, 1152

- (1970)
- 6) M. S. Walker and I. C. Rowe, Corrosion, **25**, 47
(1969)
- 7) J. E. Reinoehl, F. H. Beck and M. G. Fontana,
ibid., **26**, 141(1970)
- 8) B. E. Wilde, ibid., **28**, 283(1972)
- 9) P. E. Morris and R. C. Scarberry, ibid., **28**, 444
(1972)
- 10) N. D. Greene and R. B. Leonard, Electrochim.
Acta, **8**, 173(1973)
- 11) A. Broli, H. Holtan and M. Midgo, Br. Corros. J.,
8, 173(1973)
- 12) S. Brennert, J. Iron and Steel Inst., **135**, 101
(1973)
- 13) H. P. Leckie and H. H. Uhlig, J. Electrochem.
Soc., **113**, 1262(1966)
- 14) M. Prazak, Corrosion, **19**, 75t(1963)
- 15) N. D. Tomashov, G. P. Chernova and O. N. Mar-
cova, ibid., **20**, 166t(1964)
- 16) Z. Szkłarska-Smialowska and M. Janik-Czachor,
Br. Corros. J., **4**, 138(1969)
- 17) T. Suzuki and Y. Kitamura, Corrosion, **28**, 1
(1972)